

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年3月1日(2007.3.1)

【公開番号】特開2001-196289(P2001-196289A)

【公開日】平成13年7月19日(2001.7.19)

【出願番号】特願2000-3119(P2000-3119)

【国際特許分類】

<i>H 01 L</i>	<i>21/027</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 03 F</i>	<i>7/11</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 03 F</i>	<i>7/30</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 03 F</i>	<i>7/40</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>G 03 F</i>	<i>7/42</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>21/28</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>21/312</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>21/3065</i>	<i>(2006.01)</i>
<i>H 01 L</i>	<i>21/3213</i>	<i>(2006.01)</i>

【F I】

<i>H 01 L</i>	<i>21/30</i>	5 6 3
<i>G 03 F</i>	<i>7/11</i>	5 0 3
<i>G 03 F</i>	<i>7/30</i>	
<i>G 03 F</i>	<i>7/40</i>	5 2 1
<i>G 03 F</i>	<i>7/42</i>	
<i>H 01 L</i>	<i>21/28</i>	E
<i>H 01 L</i>	<i>21/312</i>	D
<i>H 01 L</i>	<i>21/312</i>	M
<i>H 01 L</i>	<i>21/302</i>	1 0 1 D
<i>H 01 L</i>	<i>21/302</i>	1 0 4 H
<i>H 01 L</i>	<i>21/88</i>	C

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月10日(2007.1.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

他の方法として現像液の侵入だけを考えた場合、図9に示すように、例えば特開平6-1110199号公報に示された、基板402上に形成されたA1およびCuの合金膜401上に後述する現像液に対する溶解レートの低い有機系反射防止膜403を回転塗布法にて形成し、その有機系反射防止膜403上にレジスト405を形成する方法がある。しかし有機系反射防止膜403は、露光時の下地401からの反射を低減させるためには所定の膜厚が必要であり、例えば露光光として遠紫外線を使用するような場合は100nm程度と厚い膜厚が必要となる。